【物件名】

刊行物2:

【添付書類】

刊行物2:

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-8860

(P2002-8860A) (43)公開日 平成14年1月11日(2002.1.11)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI	テーマコート' (参え			
H05B 33/14		. HO5B 33/14	В 3К007			
CO9K 11/06	645	CO9K 11/06	645			
	660		660			
	690		690			
HO5B 33/22		H05B 33/22	В			
		審查請求	* 未請求 請求項の数8 OL (全17頁)			
(21) 出願番号	特顆2000~135306(P2000~135306)	(71)出願人				
(22) 出願 8	平成12年5月9日(2000.5.9)		三菱化学株式会社			
(22) (LUNST 17	平成12年5月9日(2000, 5. 9)	(72)発明者	東京都千代田区丸の内二丁目 5番 2 号 佐藤 佳晴			
(31) 優先接士張来县	特順2000~116124 (P2000~116124)	(12) 光明日	在際 注明 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地			
(32) 優先日	平成12年4月18日(2000.4.18)		三菱化学株式会社横浜総合研究所内			
(33)優先梅主張国	日本 (JP)	(72) 発明者				
		(12) 30.574	神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地			
		- 1	三菱化学株式会社横浜総合研究所内			
		(74)代理人				
			弁理士 長谷川 鳴司			
			开埋士 長谷川 鳴可 最終頁に統・			

(54) 【発明の名称】有機電界発光素子

(57)【要約】

【課題】 燐光発光を利用した有機電界発光素子において、素子の発光効率を改善すると共に、駆動安定性を充分に確保する。を提供する。

【解決手段】 基板上に、陽極、発光層、および陰極が順次積層されてなる有機電界発光素子において、発光層が、主成分としてN-フェニルカルバソール骨格を有する化合物を、また副成分として周期律表7ないし11族から選ばれる少なくとも一つの金属を含む有機金属錯体を含有しており、かつ、発光層と陰極との間に下記一般式(1)で表される化合物を含有する正孔阻止層を有することを特徴とする有機電界発光素子。

【化1】

$$\begin{bmatrix} R^2 & R^1 \\ R^4 & N \\ R^5 & R^8 \end{bmatrix}_2$$
 (1)

(式中、 $R^1 \sim R^6$ は水素原子または任意の置換基を表し、Mはアルミニウム、ガリウム、インジウムから選ばれる金属原子を表す。一般式 (I) 中、Xは以下に示す一般式 (Ia) 、 (Ib) 、 (Ic) のいずれかで表される。)

(式中、Ar'〜Ar'は、置換基を有していてもよい芳香 族炭化水森環基または置換基を有していてもよい芳香族 複素霖基を表し、Yはシリコンまたはゲルマニウムを表す。)

(2)

特開2002-8860 2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、陽極、発光層、および陰極が 順大積層されてなる有機電界発光素子において、

発光層が、Nーフェニルカルパゾール骨格を有する化合 物と、周期律表7ないし11族から選ばれる少なくとも 一つの金属を含む有機金属錯体を含有しており、かつ、 発光層と陰極との間に下記一般式(I)で表される化合 物を含有する正孔阻止層を有することを特徴とする有機 健界発光索子。

[化1]

(1)

(式中、 $R^1 \sim R^0$ は水素原子または任意の置換基を表 し、Mはアルミニウム、ガリウム、インジウムから選ば れる金属原子を表す。一般式(1)中、Xは以下に示す 一般式 (Ia) 、 (Ib) 、 (Ic) のいずれかで表され る。) 【化2】

-0-0-Ar2 (Ib)

10

(式中、Ar'~Ar⁶は、置換基を有していてもよい芳香 族炭化水素環基または置換基を有していてもよい芳香族 複素環基を表し、Yはシリコンまたはゲルマニウムを表 t.)

【請求項2】 一般式 (1) において、R'~R'が、 水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、 アルケニル基、アリル基、シアノ基、アミノ基、アシル 基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコ 30 【化3】 キシ基、アルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、

置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基または置 換基を有していてもよい芳香族複素環基である、請求項 1記載の有機電界発光素子。

【請求項3】 N-フェニルカルパゾール骨格を有する 化合物が、下記一般式 (II) で表される化合物であるこ とを特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素

(II)

(式中、2は2価の連結基を示す。カルパゾリル基およ びフェニレン基は、各々任意の置換基を有していてもよ

【請求項4】 一般式 (II) で表されるN フェニルカ

ルパゾール骨格を有する化合物が、下記一般式 (II') で表されることを特徴とする、請求項3記載の有機電界 40 発光素子。

【化4】 . R12 (II)

(式中、 $R^{\dagger} \sim R^{\prime *}$ は各々独立に、水素原子、ハロゲン ノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルポニル基、 原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シア 50 カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、ア (3)

特開2002-8860

ラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリール オキシ基、慢換基を有していてもよい芳香族炭化水薬燥 基または芳香族複素環基を表わし、R¹ とR¹¹、R¹¹とR¹²、R¹¹とR¹³、R¹¹とR¹⁴、R¹⁵とR 「* はそれぞれ隣接する置換基同上で環を形成してもよい。 Zは2個の連結基を示し、直接結合、酸素原子、硫 黄原子、以下に示す連結基、

【化5】

置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基または芳香族複素環基のいずれかで表される。

【請求項5】 周期律表7ないし11族の金属が、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、銀、レニウム、オスミウム、イリジウム、白金、および金から選ばれることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項6】 発光層と陽便との間に、正孔輸送層を有することを特徴とする請求項1ないし5のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【請求項7】 正孔阻止層と陰極との間に、電子輸送層 を有することを特徴とする請求項1ないし6のいずれか 20 ・項に記載の有機電界発光素子。

【請求項8】 正孔阻止層の膜厚が、 0.5~50nmの範囲 にあることを特徴とする請求項1ないし7のいずれかに 記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機電界発光素子に 関するものであり、詳しくは、有機化合物から成る発光 層に電界をかけて光を放出する薄膜型デバイスに関する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来、薄膜型の電界発光(EL)素子としては、無機材料のII-VI族化合物半導体であるZnS、CaS、SrS等に、発光中心であるMnや希土類元素(Eu、Ce、Tb、Sm等)をドープしたものが一般的であるが、上記の無機材料から作製したBL素子は、

- 1) 交流駆動が必要 (50~1000 Hz)、
- 2) 駆動電圧が高い (~200 V)、
- 3) フルカラー化が困難(特に青色)、
- 4) 周辺駆動回路のコストが高い、

という問題点を有している。

【0003】しかし、近年、上記問題点の改良のため、 有機薄膜を用いたEL桌子の開発が行われるようになっ た。特に、発光効率を高めるため、電極からのキャリア 一注入の効率向上を目的として電極の種類の最適化を行 い、芳香族ジアミンから成る正孔輸送層と8-ヒドロキ シキノリンのアルミニウム錯体から成る発光層とを設け た有機電界発光素子の開発(Appl. Phys. Lett., 51巻, 913頁, 1987年)により、従来のアントラセン等の単結 50

晶を用いたEL素子と比較して発光効率の大幅な改善が 10 なされ、実用特性に近づいている。

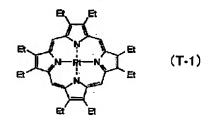
【0004】上記の様な低分子材料を用いた電界発光素子の他にも、発光層の材料として、ポリ(pーフェニレンビニレン)、ポリ [2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-1,4-フェニレンビニレン]、ポリ (3-アルキルチオフェン) 等の高分子材料を用いた電界発光素子の開発や、ポリビニルカルパゾール等の高分子に低分子の発光材料と電子移動材料を混合した素子の開発も行われている。

【0005】ところで乗子の発光効率を挙げる試みとして、蛍光ではなく燐光を用いることも検討されている。 燐光を用いる、即ち、三重項励起状態からの発光を利用 すれば、従来の蛍光(一電項)を用いた素子と比べて、 3倍程度の効率向上が期待される。この目的のためにク マリン誘導体やベンソフェノン誘導体を発光層とすることが検討されたが(第51回応用物理学会連合講演会、28 a-PB-7、1990年)、優めて低い輝度しか得られなかった。その後、三重項状態を利用する試みとして、ユーロ ピウム錯体を用いることが検討されてきたが、これも高 効率の発光には至らなかった。

【0006】最近、以下に示す白金錯体(T-1)を用いることで、高効率の赤色発光が可能なことが報告された (Nature, 395巻, 151頁, 1998年)。その後、以下に示すイリジウム錯体(T-2)を発光層にドープすることで、さらに緑色発光で効率が大きく改善されている (Appl. Phys. Lett., 75巻, 4頁, 1999年)。

[0007]

化6]



【0008】 【化7】 (4)

[0009]

【発明が解決しようとする課題】有機電界発光素子をフ めには、素子の発光効率を改善すると同時に駆動時の安 定性を十分に確保する必要がある。しかしながら、前述 の文献に記載の燐光分子 (T-2) を用いた高効率の有 機電界発光素子では、駆動安定性が実用には不十分であ るのが現状である (Jpn. J. Appl. Phys., 38巻, L1502 頁, 1999年)。

【0010】上記の駆動劣化の主原因は、例えば基板/ 陽極/正孔輸送層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/ 陰極、の素子構造における正孔阻止層の薄膜形状の劣化 によると推定される。この薄膜形状の劣化は、素子駆動 20 時の発熱等による有機非晶質薄膜の結晶化(または凝 集)等に起因すると考えられている。この耐熱性の低さ は材料のガラス転移温度(以下Tgと略す)の低さに由来 すると考えられる。前述の文献(燐光分子として(T-2) を用いた素子に関するもの)では、正孔阻止層とし て以下に示すフェナントロリン化合物

[0011]

[化8]

【0012】を使用しているが、この化合物は分子量が 小さいために容易に結晶化・凝集して薄膜形状が劣化す る。正孔阻止層の役割は、陽極より注入された正孔が電 子輸送層にリークするのを阻止して、正孔と電子の再結 合領域を発光層内に限定することである。これにより発 40 光層の高効率化が可能となるが、正孔阻止層の薄膜の均

特開2002-8860

6

一性が結晶化・凝集により失われると、上記の正孔阻止 能力が低下し、結果として、発光効率及び発光輝度の低 下を招く。

【0013】上述の理由から、燐光分子を用いた有機電 界発光素子は、実用化に向けて素子の駆動安定性に大き な問題を抱えているのが実状である。有機電界発光素子 の駆動安定性が改善されないことは、フラットパネル・ ディスプレイ等の表示素子や照明等の応用を考える上で 望ましくない。本発明者は上記実状に鑑み、高効率かつ ラットパネル・ディスプレイ等の表示素子に応用するた 10 高い駆動安定性を有する有機電界発光素子を提供するこ とを目的として鋭意検討した結果、正孔阻止層に特定の 有機金属錯体化合物を用いることで、上記課題を解決す ることができることを見い出し、本発明を完成するに至 った。

[0014]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明の要旨 は、基板上に、陽極、発光層、および陰極が順次積層さ れてなる有機電界発光素子において、発光層が、Nーフ エニルカルバゾール骨格を有する化合物と、周期律表で ないし11族から選ばれる少なくとも一つの金属を含む 有機金属錯体を含有しており、かつ、発光層と陰極との 間に下記一般式(1)で表される化合物を含有する正孔 阻止層を有することを特徴とする有機電界発光素子に存 する。

[0015] 【化9】

$$\begin{bmatrix} R^{3} & R^{1} \\ R^{4} & N \\ R^{5} & R^{6} \end{bmatrix}_{2}^{M-X}$$
 (1)

【0016】 (式中、R'~R'は水素原子または任意 の置換基を表し、Mはアルミニウム、ガリウム、インジ ウムから選ばれる金属原子を表す。一般式(I)中、X は以下に示す一般式 (Ia) 、 (Ib) 、 (Ic) のいずれか で表される。)

[0017]

【化10】

$$-o-Ar^1$$
 (Ia) $-o-C-Ar^2$ (Ib) $-o-Y-Ar^4$ (Ic)

【0018】 (式中、Ar³~Ar³は、置換基を有してい てもよい芳香族炭化水素環基または置換基を有していて もよい芳香族複素環基を表し、Yはシリコンまたはゲル マニウムを表す。)

[0019]

【発明の実施の態様】本発明は、N-フェニルカルバソ ール骨格を有する化合物と、周期律表 7 族ないし 1 1 族 から選ばれる少なくとも…つの金属を含む有機金属錯体 を含有する発光層をもつ、いわゆる燐光を利用した有機 50 電界発光素子において、前記一般式(1)で表される化

(5)

特開2002-8860

8

合物を含んだ正孔阻止層を有する点が特徴である。また 本発明における「正孔阻止層」は、発光層の陰極側の界 面に接して設けられている層をさす。

7

【0020】前記一般式(I)において、R'~R'は 水素原子または任意の置換基を表すが、好ましくは水素 原子:塩素、臭素等のハロゲン原子:メチル基、エチル 基等の炭素数1~6のアルキル基;ベンジル基等のアラ ルキル基:ビニル基等の炭素数2~6のアルケニル基; シアノ基;アミノ基;アシル基;メトキシ基、エトキシ ル基、エトキシカルボニル基等の炭素数1~6のアルコ キシカルボニル基:カルボキシル基:フェノキシ基、ベ ンジルオキシ基などのアリールオキシ基;ジエチルアミ ノ基、ジイソブロピルアミノ基等のジアルキルアミノ 基;ジベンジルアミノ基、ジフェネチルアミノ基などの ジアラルキルアミノ基;トリフルオロメチル基等のα-ハロアルキル基:水酸基;置換基を有していてもよいフ エニル基、ナフチル基等の芳香族炭化水素環基;置換基 を有していてもよいチエニル幕、ピリジル基等の芳香族 複素環基を表わす。

【0021】前記芳香族炭化水素環および芳香族複素環 が取りうる置換基としては、フッ素原子等のハロゲン原 ナ:メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキル

基;ビニル基等のアルケニル基;メトキシカルボニル 基、エトキシカルボニル基等の炭素数1~6のアルコキ シカルボニル基;メトキシ基、エトキシ基等の炭素数1 ~6のアルコキシ基;フェノキシ基、ベンジルオキシ基 などのアリールオキシ基;ジメチルアミノ基、ジエチル アミノ基等のジアルキルアミノ基、アセチル基等のアシ ル基、トリフルオロメチル基等のハロアルキル基、シア ノ基等が挙げられる。

【0022】R'ないしR°としてより好ましくは水桒原 基等の炭素数1~6のアルコキシ基;メトキシカルボニ 10 子、アルキル基、ハロゲン原子、またはシアノ基が挙げ られる。またR'としては、特にシアノ基が好ましい。 MはA1 原子、Ga 原子またはIn原子を示す。 Xは前記 一般式 (Ia)、 (Ib)、または (Ic) のいずれかで表わ され、各式中、YはSi またはGe のいずれかの原子を 表し、Ar'~Ar'は、置換基を有していてもよいフェニ ル基、ビフェニル基、ナフチル基等の芳香族炭化水素環 基またはチエニル基、ピリジル基等の芳香族複素環基を 表わす。

> 【0023】前記一般式(1)で表わされる化合物の好 ましい具体例を以下の表1~表2に示すが、これらに限 定するものではない。

[0024]

【表1】

		_		
番号	M	R'~R³	R⁴~R⁵	Χ
(1)	A	R1: —CHs		-0-
(2)	Al	Hi:CHs	_	~-◇-
(3)	Al	R':—CHs R':—CHs		~O-O
(4)	Al	R1: -CHs	R1:CN	~~~
(5)	Al	R ¹ : -CHs R ² : -CHs	Rf: -CN	H ₉ G H ₉ G
(8)	Ga	R¹: —CHs	R ⁴ :—CN	H₃C -0- H₃C
(7)	Al	R¹:CHs	_	~°€
(8)	Ga	R¹:CHa	-	-°£
(9)	Al	R¹: —CH3 R³: —CH6	. –	-°²₩
(10)	Ai	R1: —CHs R3: —CH3	R ⁴ ;CN	-° ₈ ∞
(11)	Al	R¹: -CH3	R4: '-CI	-° _k CO

[0025]

【表 2】

(7)

特開2002-8860

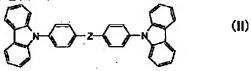
	11		· · ·	12
番号	М	R¹~R³	H+He	x
(12)	Al	R¹ : —CHs		
(13)	Ai	R¹ :CHs R³ :CHs	_	
(14)	A)	R' : —CH3	H₁:CN	
(15)	Al	R':CHs R ³ :CHs	H⁴: —CN	
(16)	Ga	R¹:—CHs R³:—CHs	R⁴: —CN	
(17)	Ai	R ¹ : —CHs	-	-0-83(CH ₃) ₃
(18)	Al ·	R':CHa	R4:-CN	-0-si(CH ₀) ₃
(19)	Al	R¹: —CHa R³: —CHa	_	-o-si(CH ₃) ₃
(20)	Ga	R':—CHs R':—CHs		-0·si

【0026】尚、表中、 $R^1 \sim R^6$ で特に示していない もの、および「-」と記載されたものは水素原子を表わ す。これらの化合物は、単独で用いてもよいし、必要に 応じて、各々、混合して用いてもよい。本発明の有機電 界発光素子における発光層に含まれる、Nーフェニルカ

ルバソール骨格を有する化合物としては、好ましくは下 記一般式(II)

[0027]

【化11】



【0028】(式中、2は2価の連結基を示す。カルバ ゾリル基およびフェニレン基は、各々任意の置換基を有 していてもよい。)で表される化合物が挙げられ、より 好ましくは下記一般式 (II')

[0029]

【化12】

【0030】(式中、R¹~R¹は各々独立に、水素原 ニル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカ ルポニル基、カルポキシル基、アルコキシ基、アルキル アミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸 基、アリールオキシ基、置換基を有していてもよい芳香 族炭化水素環基または芳香族複素環基を表わし、Riと

R' , R" &R'4, R'12 &R'2, R13 &R'4, R'15 &R イ、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケ 10 ¹⁶、R¹⁷とR¹⁶はそれぞれ**隣接する置換基**同上で環を形 成してもよい。2は2価の連結基を示し、より具体的に は直接結合、酸素原子、硫黄原子、以下に示す連結基、 [0031] 【化13】

環基または芳香族複素環基、または、以下に示す一般式

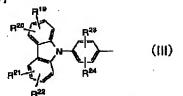
(11a) 、 (IIb) のいずれかで表される。

[0033]

【化14】

【0034】 (式中、Ar[®]及びAr[']は、各々独立して、 置換基を有していてもよい 2 価の芳香族炭化水素環基ま たは芳香族複素環幕、または以下の一般式 (III) で表 わされる。

[0035] 【化15】



【0036】 (式中、R12~R14は各々独立に、水素原 ナ、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケ ニル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカ ルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキル アミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸 基、アリールオキシ基、置換基を有していてもよい芳香 族炭化水素環基または芳香族複素環基を表わし、R¹³と

【0032】置機基を有していてもよい芳香族炭化水素 20 基同上で環を形成してもよい。))で表される化合物が 挙げられる。

> 【0037】前配一般式 (II') において、R'~R'* として具体的には、水素原子; ハロゲン原子: メチル 基、エチル基等の炭素数1~6のアルキル基:ベンジル 基等のアラルキル基:ピニル基等の炭素数2~6のアル ケニル基:シアノ基:アミノ基:アシル基:メトキシ 基、エトキシ基等の炭素数1~6のアルコキシ基;メト キシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数2 ~6のアルコキシカルボニル基;カルボキシル基;フェ 30 ノキシ基、ベンジルオキシ基などのアリールオキシ基; ジエチルアミノ基、ジイソプロビルアミノ基等のジアル キルアミノ基;ジベンジルアミノ基、ジフェネチルアミ ノ基などのジアラルキルアミノ基; トリフルオロメチル 基等のαーハロアルキル基;木酸基;置換基を有してい てもよいフェニル基、ナフチル基等の芳香族炭化水素環 基:置換基を有していてもよいチエニル基、ピリジル基 等の芳香族複素電差を表す。

> 【0038】前記芳香族炭化水素環基及び芳香族複素環 基が取りうる置換基としては、フッ素原子等のハロゲン 40 原子;メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキル 基;ビニル基等の炭素数2~6のアルケニル基;メトキ シカルポニル基、エトキシカルポニル基等の炭素数2~ Bのアルコキシカルボニル基;メトキシ基、エトキシ基 等の炭素数1~6のアルコキシ基;フェノキシ基、ベン ジルオキシ基などのアリールオキシ基;ジメチルアミノ 基;ジエチルアミノ基等のジアルキルアミノ基;アセチ ル基等のアシル基;トリフルオロメチル基等のハロアル キル基;シアノ基等が挙げられる。

【0039】なおR'とR'、R'とR''、R''と R^{**}、R^{**}とR^{**}、R^{**}とR^{**}はそれぞれ隣接する置換。50 R^{**}、R^{**}とR^{**}、R^{**}とR^{**}、R^{**}とR^{**}はそれぞれ 連結基、

[0040]

(9)

特開2002~8860

16

15

隣接する置換基同上で結合し、ベンゼン環、シクロヘキ サン環等を形成してもよい。 Zは2価の連結基を示し、 好ましくは直接結合、酸素原子、硫黄原子、以下に示す

【化16】

【0041】置換基を有していてもよいベンゼン環等の 芳香族炭化水素環基またはチオフェン環等の芳香族複素 いずれかで表される。

[0042]

【化17】



【0043】式中、Ar^t 及びAr⁷は、各々独立して、置 換基を有していてもよいベンゼン環、ナフタレン環等の 芳香族炭化水素燥基またはチオフェン環、フラン環、ビ 20 リジン環等の芳香族複素環基、または以下の一般式(II 1) で表わされる。

[0044]

【化18】

【0045】式中、R¹³~R²⁴は各々独立に、水素原 子;ハロゲン原子;メチル基、エチル基等の炭素数1~ 6のアルキル基;ベンジル基等のアラルキル基;ビニル 基等のアルケニル基;シアノ基;アミノ基;アシル基; メトキシ基、エトキシ基等の炭素数1~6のアルコキシ 基:メトキシカルボニル基。エトキシカルボニル基等の 炭素数2~6のアルコキシカルポニル基:カルボキシル 基;フェノキシ基、ペンジルオキシ基などのアリールオ キシ蒸;ジエチルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基等 40 のジアルキルアミノ基:ジペンジルアミノ基、ジフェネ チルアミノ基などのジアラルキルアミノ基;トリフルオ ロメチル基等のα-ハロアルキル基;水酸基;置換基を 有していてもよいフェニル基、ナフチル基等の芳香族炭 化水素環基;置機基を有していてもよいチェニル基、ビ リジル基等の芳香族複素環基を表わす。

【0046】前記芳香族炭化水素環基および芳香族複素 環基が取りうる置換基としては、フッ素原子等のハロゲ ン原子;メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキ ル基;ビニル基等の炭素数2~6のアルケニル基;メト 50

キシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数1 ~6のアルコキシカルポニル基;メトキシ基、エトキシ 環基、または、以下に示す一般式(IIa) 、(IIb) の 10 基等の炭素数1~6のアルコキシ基;フェノキシ基、ベ ンジルオキシ基などのアリールオキシ基;ジメチルアミ ノ基、ジエチルアミノ基等のジアルキルアミノ基:アセ チル基等のアシル基;トリフルオロメチル基等のハロア ルキル基:シアノ基等が挙げられる。

> · 【0047】なおR''とR''、R"とR''、R"'とR'' はそれぞれ隣接する置換基同上で結合し、ベンゼン環や シクロヘキサン環環を形成してもよい。 前記一般式 ([1') で表わされる化合物の好ましい具体例を以下に示 すが、これらに限定するものではない。

[0048]

化19]

[0049] [化20]

(10) 特開2002-8860

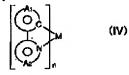
| H-7 | H-7 |
| H-8 |
| H-10 |
| H-11 |
| H-12 |
| H-11 |
| H-11 |
| H-12 |
| H-12 |
| H-12 |
| H-13 |
| H-1

【0050】これらの化合物は、単独で用いてもよい。 ひし、必要に応じて、各々、混合して用いてもよい。 次に、本発明の有機電界発光素子における発光層に含まれる。 周期律表7ないし11族から遅ばれる少なくとも一つの金属を含む有機金属錯体について説明する。 この燐光性の有機金属錯体が含有する金属として、好ましくは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、銀、レニウム、オスミウム、イリジウム、白金、および金が挙げられる。

【0051】これらの有機金属錯体は、例えば下記・・般式(IV)で表される。

40 [0052]

【化21】



【0053】式中、Mは金属、nは該金属の価数をあらわす。環A: は置換基を有していてもよい労害族炭化水50 素薬基または芳香族複素桑基を表わし、好ましくは、フ

(11)

特開2002-8860

20

エニル基、ビフェニル基、ナフチル基、アントリル基、 チエニル墓、ピリジル驀、キノリル墓、またはイソキノ リル基を表す。これらが有していてもよい置換基として は、フッ素原子等のハロゲン原子;メチル基、エチル基 等の炭素数1~6のアルキル基;ピニル基等の炭素数2 ~6のアルケニル墓;メトキシカルボニル墓、エトキシ カルボニル基等の炭素数2~6のアルコキシカルボニル 基;メトキシ基、エトキシ基等の炭素数1~6のアルコ キシ墓;フェノキシ基、ベンジルオキシ墓などのアリー ジアルキルアミノ基;アセチル基等のアシル基;トリフ ルオロメチル基等のハロアルキル基;シアノ基等が挙げ られる。

19

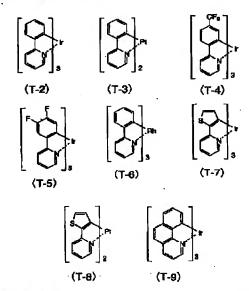
【0054】環A: は置換基を有していてもよい含窒素 芳香族複素環基を表わし、好ましくは、ピリジル基、ビ リミジル基、ピラジン基、トリアジン基、ベンゾチアソ ール基、ベンソオキサゾール基、ベンソイミダゾール 蓋、キノリル基、イソキノリル基、キノキサリン基、ま たはフェナントリジン基を表わす。これらが有していて もよい置換基としては、フッ素原子等のハロゲン原子; 20 【0057】 メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキル基;ビ ニル基等の炭素数2~6のアルケニル墓;メトキシカル

ポニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数2~6のア ルコキシカルボニル基:メトキシ基、エトキシ基等の炭 素数2~6のアルコキシ基:フェノキシ基、ペンジルオ キシ基などのアリールオキシ基;ジメチルアミノ基、ジ エチルアミノ基等のジアルキルアミノ基;アセチル基等 のアシル基;トリフルオロメチル基等のハロアルキル 基;シアノ基等が挙げられる。

【0055】なお、環Aiが有する置換基と環Aiが有す る置換基が結合することにより、一つの縮合環を形成し ルオキシ墓;ジメチルアミノ墓、ジエチルアミノ墓等の 10 てもよく、このような例としては7,8-ベンゾキノリン墓 等が挙げられる。環A:および環A:の置換基として、よ り好ましくはアルキル基、アルコキシ基、芳香族炭化水 素環基またはシアノ基が挙げられる。式(IV)における Mとして好ましくは、ルテニウム、ロジウム、パラジウ ム、銀、レニウム、オスミウム、イリジウム、白金、ま たは金が挙げられる。

> 【0056】前記一般式 (IV) で示される有機金属錯体 の具体例を以下に示すが、下記の化合物に限定されるわ けではない.

[化22]



【0058】以下、本発明の有機電界発光素子につい て、図面を参照しながら説明する。図 1 は本発明に用い られる一般的な有機電界発光素子の構造例を模式的に示 寸断面図であり、1は基板、2は陽極、4は正孔輸送 層、5は発光層、6は正孔阻止層、8は陰極を各々表わ す。基板1は有機電界発光素子の支持体となるものであ り、石英やガラスの板、金属板や金属箔、プラスチック 50 することがあるので好ましくない。このため、合成樹脂

フィルムやシートなどが用いられる。特にガラス板や、 ポリエステル、ポリメタクリレート、ポリカーボネー ト、ポリスルホンなどの透明な合成樹脂の板が好まし い。合成樹脂基板を使用する場合にはガスパリア性に留 意する必要がある。基板のガスパリヤ性が小さすぎる と、基板を通過した外気により有機電界発光素子が劣化

特開2002-8860

21

基板の少なくとも片面に緻密なシリコン酸化膜等を設け てガスバリア性を確保する方法も好ましい方法の一つで

【0059】基板1上には陽極2が設けられるが、陽極 2は正孔輸送層への正孔注入の役割を果たすものであ る。この陽極は、通常、アルミニウム、金、銀、ニッケ ル、パラジウム、白金等の金属、インジウム及び/また はスズの酸化物などの金属酸化物、ヨウ化鋼などのハロ ゲン化金属、カーボンブラック、あるいは、ポリ(3-メ チルチオフェン)、ポリピロール、ポリアニリン等の導 10 電性高分子などにより構成される。陽極2の形成は通 常、スパッタリング法、真空蒸着法などにより行われる ことが多い。また、銀などの金属微粒子、ヨウ化銅など の微粒子、カーボンブラック、導電性の金属酸化物微粒 子、導電性高分子微粉末などの場合には、適当なパイン ダー樹脂溶液に分散し、基板1上に塗布することにより 陽極2を形成することもできる。さらに、導電性高分子 の場合は電解重合により直接基板1上に薄膜を形成した り、基板1上に導電性高分子を頒布して陽極2を形成す ることもできる (Appl. Phys. Lett., 60巻, 2711頁, 1992年)。陽極2は異なる物質で積層して形成すること も可能である。陽極2の厚みは、必要とする透明性によ り異なる。透明性が必要とされる場合は、可視光の透過 率を、通常、60%以上、好ましくは80%以上とすること が望ましく、この場合、厚みは、通常、 5 ~1000nm, 好 ましくは10~500nm程度である。不透明でよい場合は陽 極2は基板1と同一でもよい。また、さらには上記の陽 極2の上に異なる導電材料を積層することも可能であ

【0060】陽極2の上には正孔輸送層4が設けられ る。正孔輸送層の材料に要求される条件としては、陽極 からの正孔注入効率が高く、かつ、注入された正孔を効 率よく輸送することができる材料であることが必要であ る。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さく、可 視光の光に対して透明性が高く、しかも正孔移動度が大 きく、さらに安定性に優れ、トラップとなる不純物が製 造時や使用時に発生しにくいことが要求される。また図 1の構成の素子の場合、発光層5に接するために発光層 からの発光を消光したり、発光層との間でエキサイブレ ックスを形成して効率を低下させないことが求められ る。上記の一般的要求以外に、車載表示用の応用を考え た場合、素子にはさらに耐熱性が要求される。従って、 Tgとして85℃以上の値を有する材料が望ましい。

【0061】このような正孔輸送材料としては、例え ば、4.4'-ビス [N- (1-ナフチル) -N-フェニルアミノ] ピフェニルで代表される2個以上の3級アミンを含み2 個以上の縮合芳香族環が窒素原子に置換した芳香族ジア ミン (特開平5-234681号公報)、4,4',4"-トリス(1-ナフチルフェニルアミノ) トリフェニルアミン等のスタ

n., 72-74巻、985頁、1997年)、トリフェニルアミンの 四量体から成る芳香族アミン化合物 (Chem. Commun., 21 75頁、1996年)、2,2',7,7'-テトラキス-(ジフェニルア ミノ)-9.9'-スピロピフルオレン等のスピロ化合物 (Syn th. Metals, 91巻、209頁、1997年》等が挙げられる。 これらの化合物は、単独で用いてもよいし、必要に応じ て、各々、混合して用いてもよい。

22

【0062】上記の化合物以外に、正孔輸送層4の材料 として、ポリビニルカルバソール、ポリビニルトリフェ ニルアミン (特開平 7- 53953号公報) 、テトラフェニ ルベンジジンを含有するポリアリーレンエーテルサルホ ン (Polym. Adv. Tech., 7巻、33頁、1996年) 等の高分 子材料が挙げられる。塗布法の場合は、正孔輸送材料を 1種または2種以上と、必要により正孔のトラップにな らないバインダー樹脂や塗布性改良剤などの添加剤とを 添加し、溶解して塗布溶液を調製し、スピンコート法な どの方法により陽極2上に塗布し、乾燥して正孔輸送層 36を形成する。バインダー樹脂としては、ポリカーボネ ート、ポリアリレート、ポリエステル等が挙げられる。 20 バインダー樹脂は添加量が多いと正孔移動度を低下させ るので、少ない方が望ましく、通常、50重量%以下が 好ましい。

【0063】真空蒸着法の場合には、正礼輸送材料を真 **空容器内に設備されたルツボに入れ、真空容器内を適当** な真空ポンプで10 Pa程度にまで排気した後、ルツボを 加熱して、正孔輸送材料を蒸発させ、ルツボと向き合っ て置かれた、陽極が形成された基板1上に正孔輸送層4 を形成させる。正孔輸送層4の膜厚は、通常、5~300m m、好ましくは 10~100nmである。この様に薄い膜を--30 様に形成するためには、一般に真空蒸着法がよく用いら

【0064】正孔輸送層4の上には発光層5が設けられ る。発光層5は、前述したNーフェニルカルバゾール骨 格を有する化合物と、前述した周期律表でないし11族 から選ばれる金属を含む有機金属錯体を含み、電界を与 えられた電極間において、陽極から注入されて正孔輸送 層を移動する正孔と、陰極から注入されて正孔阻止層 6 を移動する電子との再結合により励起されて、強い発光

【0065】本発明の有機電界発光素子における発光層 は、前記N-フェニルカルパゾール骨格を有する化合物 と、前記有機金属錯体を含有するが、より好ましくは、 主成分として前記N-フェニルカルパゾール骨格を有す る化合物を、また副成分として前配有機金属錯体を含有 する。ここで「主成分」とは該層を形成する材料のうち 50 重量%以上を占めるものを意味し、「副成分」とは 波層を形成する材料のうち50重量%未満を占めるもの を意味する。なお発光層 5 は、本発明の性能を損なわな い範囲で、他のホスト材料(N・フェニルカルバゾール --バースト構造を有する芳香族アミン化合物 (J. Lumi 50 骨格を有する化合物と同様の働きを行う) や蛍光色素な (13)

10

特開2002-8860

24

ど、他成分を含んでいても良い。

【0068】前記一般式(IV)で表わされる有機金属錯 体が発光層中に含有される量は、0.1~30食量%の範囲 にあることが好ましい。 0.1電量%以下では素子の発光 効率向上に寄与できず、30電量%を越えると有機金属錯 体間上が2量体を形成する等の濃度消光が起き、発光効 率の低下に至る。從来の蛍光(一重項)を用いた素子に おいて、発光層に含有される蛍光性色素(ドーパント) の量より、若干多い方が好ましい傾向がある。有機金属 錯体が発光層中に膜厚方向に対して部分的に含まれた り、不均一に分布してもよい。

23

【0067】発光層5の膜厚は、通常、10~200 nm、好 ましくは20~100 mmである。正孔輸送層4と同様の方法 により薄膜形成される。本発明では、正孔阻止層として 前記一般式(1)で表わされる化合物を含有する層を、 発光層5の陰極8側の界面に接して配置することを特徴 とする。正孔阻止層6は、正孔輸送層から移動してくる 正孔を陰極に到達するのを阻止する役割と、陰極から注 入された電子を効率よく発光層の方向に輸送することが 料に求められる物性としては、電子移動度が高く正孔移 動度が低いことが必要とされる。正孔阻止層6は正孔と 電子を発光層内に閉じこめて、発光効率を向上させる機 能を有する。

【0068】このような条件を満たす正孔阻止層材料と 1.は、前記一般式(1)で表わされる混合配位子錯体が 挙げられる。正孔阻止層6の隣厘は、通常、 0.3~ 100 nm 好ましくは 0.5~50nmである。正孔阻止層も正孔輪 送層と同様の方法で形成することができるが、通常は真 空燕着法が用いられる。

【0069】陰極8は、正孔阻止層6を介して発光層5 に電子を注入する役割を果たす。陰極8として用いられ る材料は、前記陽極2に使用される材料を用いることが 可能であるが、効率よく電子注入を行なうには、仕事関 数の低い金属が好ましく、スズ、マグネシウム、インジ ウム、カルシウム、アルミニウム、銀等の適当な金属ま たはそれらの合金が用いられる。具体例としては、マグ ネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合金、ア ルミニウムーリチウム合金等の低仕事関数合金電極が挙 げられる。さらに、陰極と発光層または電子輸送層の界 面にLiF 、MgFa 、Lia 0等の極薄絶縁膜 (0.1~5nm) を挿 入することも、素子の効率を向上させる有効な方法であ る (Appl. Phys. Lett., 70巻, 152頁, 1997年;特開平 10- 74586号公報; IEEETrans. Electron. Devices, 44 巻, 1245頁, 1997年)。陰極8の膜厚は通常、陽極2と 同様である。低仕事関数金属から成る陰極を保護する目 的で、この上にさらに、仕事関数が高く大気に対して安 定な金属層を積層することは素子の安定性を増す。この 目的のために、アルミニウム、銀、銅、ニッケル、クロ ム、命、白金等の金属が使われる。

【0070】素子の発光効率をさらに向上させることを 目的として、正孔阻止層6と陰極8の間に電子輸送層? を設けることが考えられる(図2参照)。電子輸送層7 は、電界を与えられた電極間において陰極から注入され た電子を効率よく正孔阻止層6の方向に輸送することが できる化合物より形成される。電子輸送層でに用いられ る電子輸送性化合物としては、陰極8からの電子注入効 率が高く、かつ、高い電子移動度を有し注入された電子 を効率よく輸送することができる化合物であることが必 悪である。

【0071】このような条件を満たす材料としては、8 ーヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体などの金属錯 体 (特開昭59-194393号公報)、10-ヒドロキシベンゾ [h]キノリンの金属錯体、オキサジアゾール誘導体、ジ スチリルピフェニル誘導体、シロール誘導体、3-または 5-ヒドロキシフラボン金属館体、ベンズオキサゾール金 **鳳錯体、ベンゾチアゾール金鳳錯体、トリスベンズイミ** ダソリルベンゼン (米国特許第 5,645,948号) 、キノキ サリン化合物 (特開平6-207169号公報)、フェナント できる化合物より形成される。正孔阻止層を構成する材 20 ロリン誘導体(特開平 5 - 331459号公報)、2-t-ブチル -9, 10-N, N' -ジシアノアントラキノンジイミン、n型水 素化非晶質炭化シリコン、n型硫化亜鉛、n型セレン化 亜鉛などが挙げられる。電子輸送層6の膜厚は、通常、 5~200nm、好ましくは10~100 mmである。

> 【0072】電子輸送層7は、正孔輸送層4と同様にし て統布法あるいは真空蒸着法により正孔阻止層 6 上に積 層することにより形成される。通常は、真空蒸着法が用 いられる。正孔注入の効率をさらに向上させ、かつ、有 機層全体の陽極への付着力を改善させる目的で、正孔輪 30 送層4と陽極2との間に陽極バッファ層3を挿入するこ とも行われている(図3参照)。陽極バッファ層3を挿 入することで、初期の秦子の駆動電圧が下がると同時 に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制さ れる効果がある。陽極パッファ層に用いられる材料に要 求される条件としては、楊極とのコンタクトがよく均一 な薄膜が形成でき、熱的に安定、すなわち、融点及びガ ラス転移温度が高く、融点としては 800℃以上、ガラス 転移温度としては 100℃以上が要求される。さらに、イ オン化ポテンシャルが低く陽極からの正孔注入が容易な こと、正孔移動度が大きいことが挙げられる。

【0073】この目的のために、これまでに觸フタロシ アニン等のタロシアニン化合物 (特開昭63-295695号公 報)、ポリアニリン(Appl. Phys. Lett., 64巻、1245 頁,1994年)、ポリチオフェン (Optical Materials, 9 巻、125頁、1998年)等の有機化合物や、スパッタ・カ ーボン膜 (Synth. Met., 91巻、73頁、1997年) や、バ ナジウム酸化物、ルテニウム酸化物、モリブデン酸化物 等の金属酸化物 (J. Phys. D, 29巻、2750頁、1996年) が報告されている。

50 【0074】陽極パッファ層の場合も、正孔輸送層と同

25

様にして糠膜形成可能であるが、無機物の場合には、さらに、スパッタ法や電子ビーム蒸着法、プラズマCVD 法が用いられる。以上の様にして形成される陽極パッファ層3の膜厚は、通常、3~100nm、好ましくは5~50nmである。

【0075】前、図1とは逆の構造、すなわち、基板上に陰極8、正孔阻止層6、発光層5、正孔輸送層4、陽極2の順に積層することも可能であり、既途したように少なくとも一方が透明性の高い2枚の基板の間に本発明の有機電界発光素子を設けることも可能である。同様に、図2および図3に示した前配各層構成とは逆の構造に積層することも可能である。

【0076】本発明は、有機電界発光素子が、単一の素子、プレイ状に配置された構造からなる素子、陽極と陰極がX-Yマトリックス状に配置された構造のいずれにおいても適用することができる。本発明の有機電界発光素子によれば、特定の骨格を有する化合物を発光層に、また正孔阻止層に正孔阻止能力の高く輝膜形状が安定な化合物を用いているため、従来の一環項状態からの発光を用いた素子よりも発光効率が高くかつ駆動安定性にお20いても大きく改善された素子が得られ、フルカラーあるいはマルチカラーのパネルへの応用において優れた性能を発揮できる。

[0077]

【実施例】次に、本発明を実施例によって更に具体的に 説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の 実施例の記載に限定されるものではない。

実施例1

図3に示す構造を有する有機電界発光素子を以下の方法 で作製した。

【0078】ガラス基板上にインジウム・スズ酸化物(1TO)透明導電膜を 150mm堆積したもの(ジオマテック社製:電子ビーム成膜品;シート抵抗15Q)を通常のフォトリソグラフィ技術と塩酸エッチングを用いて 2mm幅のストライブにバターニングして陽極を形成した。パターン形成したITO基板を、アセトンによる超音波洗浄の順で洗浄後、窒素ブローで乾燥させ、最後に紫外線オゾン洗浄を行って、真空蒸着装置内に設置した。上記装置の租排気を油回転ポンプにより行った後、装置内の真空度が2x10⁻⁶Torr(約2,7x10⁻⁴Pa)以下になるまで液体窒素トラップを備えた油拡散ポンプを用いて排気した。

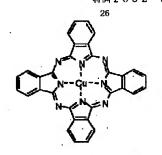
【0079】上記装置内に配置されたモリブデンボート に入れた以下に示す鍋フタロシアニン (結晶形はβ型) を加熱して兼着を行った。真空度2x10 * Torr (約2.7x10 * Pa) 、蒸着時間 1 分で蒸着を行ない、膜厚10nmの陽極 パッファ層 3 を得た。

[0080]

[化23]

(14)

特開2002-8860



【0081】次に、前記装置内に配置されたセラミック るつぼに入れた、以下に示す、4,4'-ビス [N- (1-ナフ チル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル

[0082]

【化24】

【0083】をるつぼの周囲のタンタル線ヒーターで加熱して蒸着を行った。この時のるつぼの温度は、280~270℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度1.5x10° Torr

(約2.0x10⁻⁴ Pa)、蒸着時間 3 分で膜厚80nmの正孔輸送 層 4 を得た。引続き、発光層 5 主成分として、Nーフェニルカルパゾール骨格を有する化合物 (H-1) を、燐光性有機金属鯖体として (T-2) で示したイリジウム 錆体を別々のセラミックるつぼに設置し、2 元同時蒸着 30 法により成膜を行った。化合物 (H-1) のるつぼ温度 は210~220℃の範囲とし、蒸者速度は 0.2nm/秒に制御し、イリジウム錯体 (T-2) は290~295℃の温度範囲に制御し、膜厚30nmでイリジウム錯体 (T-2) が5 電量%含有された発光層 5 を正孔輸送層 4 の上に積層した。蒸着時の真空度は1.1x10⁻⁴ Torr (約1.5x10⁻⁴ Pa) であった。

【0084】さらに、正孔阻止層6として表2に示した 化合物(12)をるつぼ温度を 220℃として、蒸岩速度0. 1nm/秒で10nmの膜厚で積層した。蒸着時の真空度は1.0x 10^{**}Torr (約1.3x10^{*4}Pa) であった。正孔阻止層 8 の上 に、電子輸送層 7 として以下の構造式に示すアルミニウ ムの8-ヒドロキシキノリン錯体、A1 (C₆H₆ NO)」、を同 様にして蒸着した。

[0085]

【化25】

50

(15)

特開2002…8860

28

ノリン錯体のるつぼ温度は 280~ 300℃の範囲で制御 し、蒸着時の真空度は1.0x10 *Torr (約1.3x10 Pa)、 蒸着速度は0.2nm/秒で膜厚は35nmとした。上記の陽極バ ッファ層、正孔輸送層、発光層、正孔阻止層及び電子輸 送層を真空蒸着する時の基板温度は室温に保持した。 【0087】ここで、電子輸送層7までの蒸着を行った 素子を一度前記真空蒸着装置内より大気中に取り出し て、陰極蒸着用のマスクとして 2mm幅のストライプ状シ ャドーマスクを、陽極2のITOストライプとは直交す るように素子に密着させて、別の真空蒸着装置内に設置 20 【0089】 して有機層と同様にして装置内の真空度が2x10 Torr (約2.7x10⁻¹Pa) 以下になるまで排気した。陰極8とし

て、先ず、フッ化マグネシウム(MgFz)をモリブデンボ ートを用いて、蒸着速度0.1nm/秒、真空度7.0x10 *Tor r (約9.3x10 1 Pa) で、1.5 nmの膜厚で電子輸送層 7 の 上に成膜した。次に、アルミニウムを同様にモリブデン ボートにより加熱して、蒸着速度0.5nm/秒、真空度1x10 **Torr(約1.3x10**Pa)で膜厚40nmのアルミニウム層を 形成した。さらに、その上に、陰極の導電性を高めるた めに銀を、同様にモリブデンボートにより加熱して、蒸 着速度0.3nm/秒、真空度1x10 * Torr (約1.3x10 * Pa) で 【0086】この時のアルミニウムの8-ヒドロキシキ 10 膜厚40nmの銀層を形成して陰極8を完成させた。以上の 3層型陰極8の蒸着時の基板温度は室温に保持した。 【0088】以上の様にして、2mmx2mm のサイズの発光 面積部分を有する有機電界発光素子が得られた。この素 子の発光特性を表一3に示す。表-3において、発光輝 度は250mA/cm3の電流密度での値、発光効率は 100cd/ m²での値、輝度/電流は輝度-電流密度特性の傾きを、 電圧は 100cd/mi での値を各々示す。素子の発光スペク トルの極大波長は 512mmであり、イリジウム錯体(T-2) からのものと同定された。

【表3】

		表 3			
	発光輝度 [cd/m²] ❷250mA/cm²	率技光会 [tm/W] @100 cd/m²	健度/電波 [cd/A]	電圧 [V] @100 cd/m²	经光 植大 [nm]
実施例 1	31170	12.3	24.6	6.3	512
実施例 2	26970	10.6	21.3	5.4	512
実施例 3	6500	2.1	4.7	7.0	585
比較例 1	29890	19.5	31,8	5.2	512
比較例 2	9030	1.6	3.1	6.2	518

【0090】この妻子の耐熱性試験を、250 mA/cmi とい う高い電流密度で駆動した時の輝度低下で評価した結果 を図4のグラフに示す。

実施例2

正孔阻止層として表2に示した化合物(13)を用いた他 40 は、実施例1と同様にして素子を作製した。発光特性を 表一3に示す。また実施例1と同様に行った、高電流密 度における駆動安定性試験の結果を図4のグラフに示 す。

【0091】 実施例3

発光層に含有させる燐光性有機金属錯体として化合物 (T-8) を用いた他は実施例1と同様にして素子を作 製した。発光特性を表-3に示す。白金錆体(T-8) に固有のオレンジ色の発光が観測された。

比較例1

正孔阻止層として、下記フェナントロリン誘導体 [0092]

【化26】

【0093】を用いた他は実施例1と同様にして素子を 作製した。この素子の発光特性を表 - 3と図4のグラフ に示す。高電流密度での駆動安定性が低いことが明らか となった。

50 比較例2

29

正孔阻止層を用いない他は実施例1と同様にして素子を作製した。この素子の発光特性を表-3に示す。特に発 光効率が大きな低下がみられた。

[0094]

【発明の効果】本発明の有機電界発光素子の陰極によれば、低電圧において高輝度・高効率で発光させることが可能となり、さらには高電流密度の駆動においても安定であり、保存時の劣化の少ない素子を得ることができる。従って、本発明による有機電界発光素子はフラットパネル・ディスプレイ(例えばOAコンピュータ用や鑒10掛けテレビ)、車載表示素子、携帯電話表示や面発光体としての特徴を生かした光源(例えば、複写機の光源、液晶ディスプレイや計器類のバックライト光源)、表示板、標識灯への応用が考えられ、その技術的価値は大きいものである。

【図面の簡単な説明】

(16)

特開2002--8860

30

【図1】有機電界発光素子の一例を示した模式断面図。

【図2】有機電界発光素子の別の例を示した模式断面 図。

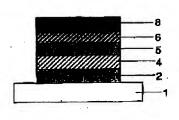
【図3】有機電界発光素子の別の例を示した模式断面図。

【図4】実施例1、2、および比較例1の駆動安定性試験の結果を示したグラフ

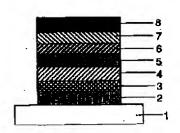
【符号の説明】

- 1 基板
- 2 陽極
- 3 陽極パッファ層
- 4 正孔輸送層
- 5 発光層
- 6 正孔阻止層
- 7 電子輸送層
- 8 陰極

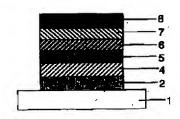
【図1】



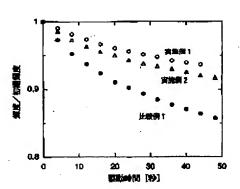
[図3]



【図2】



[図4]



(17)

特開2002-8860

プロントページの続き

(72)発明者 谷野 真代

神奈川県横浜市青業区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内 F ターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB04 AB12 CA01 CB01 DA01 DB03 EA02 EB00